

(TRANSLATION)

Ref.: No. 00-06004Z Dispatch No. 069029 Mailing Date: March 1, 2005

**NOTICE OF REASON FOR REJECTION**

Patent Application No. 2000-341040

Drafted Date: February 23, 2005

Patent Office Examiner: Takashi KAMEDA

Attorneys of the Applicant: Tsutomu TOYAMA, et al (3 others)

Applied Provisions of Patent Law: Article 29, Paragraph 2

This application is to be rejected by the following reason. If the applicant has any arguments, such arguments should be filed within 60 days from the mailing date of this Notice.

**REASON**

The inventions of the below listed claims of this application are unpatentable under Article 29, Paragraph 2 of Patent Law, as the inventions could have been easily made by one of ordinary skill in this art based on the inventions described in the below listed publications which were distributed in Japan or foreign countries, prior to filing of this application.

Notes (Cited documents are listed at the end)

Claims 1, 2, 3, 9 and 10:

Cited Documents: 1 and 2

Remarks:

The Cited Document 1 (the entire text of specification and FIG. 1) and the Cited Document 2 (mainly FIG. 2), each describes an invention of an exhaust gas purifying apparatus of an internal combustion engine, wherein a low resistance area so formed to lower a gas flow resistance is disposed in a position that a flow velocity of the exhaust gas flowing to the catalyst support is high.

Claim 4:

Cited Documents: 1, 2 and 3

Remarks:

In addition to the above-mentioned Remarks regarding Claim 3, the Cited Document 3 (mainly FIG. 1) teaches the apparatus wherein a portion, which is located more downstream in the exhaust gas flow direction than the central hole 5a which is the low resistance area, supports a larger quantity of catalyst substance than in other portions.

Claims 5 and 6:

Cited Documents: 1, 2, 3 and 4

Remarks:

In addition to the above-mentioned Remarks regarding Claim 2, the Cited Document 4 (mainly FIG. 1) teaches the apparatus wherein the notched portion is formed in the exhaust gas outflow side end surface of the catalyst support.

The Cited Document 3 (mainly FIG. 1) teaches the apparatus wherein a portion, at which the exhaust gas flow has a low resistance, supports a larger quantity of catalyst substance than in other portions.

Claims 7 and 8:

Cited Documents: 1, 2, 3 and 4

Remarks:

In addition to the above-mentioned Remarks regarding Claims 3-6, forming a plurality of notched portions, and forming the notched portion in an annular shape, can be achieved suitably by one of ordinary skill in this art.

#### LIST OF CITED DOCUMENTS

1. Micro-film of Utility Model Application No. Sho 59-152961  
(Utility Model Laid-Open Publication No. Sho 61-66610)
2. Micro-film of Utility Model Application No. Sho 63-14459  
(Utility Model Laid-Open Publication No. Hei 1-119820)
3. Patent Laid-Open Publication No. Hei 10-231722

4. Micro-film of Utility Model Application No. Hei 1-14452  
(Utility Model Laid-Open Publication No. Hei 2-105521)

- - - - -  
RECORD OF PRIOR ART DOCUMENTS SEARCH RESULT

Searched Field: IPC The 7<sup>th</sup> Edition F01N 3/

Prior Art Document: Patent Laid-Open Publication No. Hei 7-232082

This RECORD OF PRIOR ART DOCUMENTS SEARCH RESULT does not  
constitute the Reason for Rejection.

/ / / / / / / / / / / / / LAST ITEM / / / / / / / / / /

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2000-341040
起案日	平成17年 2月23日
特許庁審査官	亀田 貴志 9719 3T00
特許出願人代理人	遠山 勉(外 3名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の特許出願に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1、2、3、9、10
- ・引用文献等1、2
- ・備考

引用文献1(全文、第1図)及び引用文献2(主に第2図)には、通気抵抗が低くなるように構成した低抵抗部を、触媒担体に流入する排気の流速が高い部位に配設した内燃機関の排気浄化装置の発明が記載されている。

- ・請求項4
- ・引用文献等1、2、3
- ・備考

上記請求項3についての備考に加えて、引用文献3(主に図1)には、低抵抗部である中央孔5aより排気の流れ方向下流に位置する部位には、他の部位に比して多量の触媒物質が担持されているものが記載されている。

- ・請求項5、6
- ・引用文献等1、2、3、4
- ・備考

上記請求項2についての備考に加えて、引用文献4（主に第1図）には、切り欠き部を触媒担体における排気の流出側端面に設けたものが記載されている。

引用文献3（主に図1）には、排気の流れが低抵抗である部位には、他の部位に比して多量の触媒物質が担持されているものが記載されている。

- ・請求項7、8
- ・引用文献等1、2、3、4
- ・備考

上記請求項3～6についての備考に加えて、切り欠き部を複数形成すること、及び環状にすることは適宜設定しうるものである。

#### 引 用 文 献 等 一 覧

1. 実願昭59-152961号（実開昭61-66610号）のマイクロフィルム
  2. 実願昭63-14459号（実開平1-119820号）のマイクロフィルム
  3. 特開平10-231722号公報
  4. 実願平1-14452号（実開平2-105521号）のマイクロフィルム
- 

#### 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野      I P C 第 7 版    F 0 1 N      3 /
- ・先行技術文献      特開平 7 - 2 3 2 0 8 2

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、審査第二部原動機・流体機械  
亀田貴志（TEL 03-3501-4914 内線3355）までご連絡下さい。